

R&D 神戸製鋼技報掲載 電子材料技術文献一覧 (Vol.38 No.1 ~ Vol.48 No.2)

Papers on Electronic Materials Technologies
Presented in R&D Kobe Steel Engineering Reports (Vol. 38 No.1 ~ Vol. 48 No.2)

| | 巻 / 号 |
|---------------------------------------------------------|-------|
| アルミニウム関係 | |
| • VTR シリンダ用アルミニウム合金の諸特性 | 38/4 |
| 浅野和彦・宮上 晃・有井泰隆 | |
| • コンピュータ磁気ディスク用アルミニウム合金の組織と表面特性 | 39/4 |
| 碓井栄喜・星野晃三 | |
| • アルミニウム合金基板上への磁気記録用スパッタ媒体の直接形成 | 39/4 |
| 林 秀高・大西良彦・松村仁実 | |
| • 高品位ポリゴンミラーの加工技術 | 39/4 |
| 松下富春・本西 英・福永 浩・田口幸次・川井 浩 | |
| • 磁気ディスクサブストレート表面検査システム | 40/2 |
| 米田康司・新井明男・西元善郎・中井康秀 | |
| • 天然ダイヤモンドバイトによる感光ドラムの超精密切削 | 41/3 |
| 本西 英・大内権一郎・浅野和彦 | |
| 銅関係 | |
| • エレクトロニクス分野における新銅合金の開発動向 | 38/4 |
| 宮藤元久 | |
| • リードフレーム用 Fe-42%Ni 合金におけるめっきふくれ現象の解析 | 39/1 |
| 佐藤廣士・外山雅雄・池田眞基 | |
| • 高力 IC リードフレーム材料 FLF125 | 39/4 |
| 宮藤元久・中島安啓 | |
| • Ni めっきリードフレームの表面酸化におよぼす結晶配向性の影響 | 39/4 |
| 浅野和彦・副田益光・石川 伸 | |
| • 半導体リードフレーム用銅合金 “ KLF194-SHT ” | 42/2 |
| 宮藤元久・細川 功・津野理一 | |
| • 高級コネクタ材料 “ CAC65 ” | 42/3 |
| 宮藤元久・細川 功 | |
| • リードフレームめっき技術の動向 | 43/3 |
| 副田益光 | |
| • 高級コネクタ材料 “ CAS85 ” の機械的性質 | 44/1 |
| 宮藤元久・細川 功・三輪洋介 | |
| 超伝導の磁性関係 | |
| • 磁性複合材とその磁気特性 | 39/4 |
| 安倍 陸・青田健一・元田高司 | |
| • Pr-Fe-B 磁石の新しい製造方法 | 39/4 |
| 大木継秋・由利 司・吉田千里・神戸章史・高橋洋一・宮川陸啓 | |
| • 磁気ヘッド用高磁束密度コア材料 | 39/4 |
| 井上和生・東 正則 | |
| • 磁気メディア用スパッタリングターゲット材料 | 39/4 |
| 吉川一男・宮本隆志・小川陸郎 | |
| • 高温超電導セラミックスの HIP 処理 | 40/4 |
| 小川陸郎・林 征治・渋谷和幸・福本吉人・川手剛雄 | |
| • 酸化物超電導線材の開発とその $JC-B$ 特性 | 41/3 |
| 福本吉人・渋谷和幸・林 征治・小川陸郎・川手剛雄 | |
| • Bi-系酸化物超電導体単結晶の磁気異方性 | 42/3 |
| 林 征治・渋谷和幸・志垣一郎・小川陸郎・川手剛雄 | |
| • 酸化物超電導薄膜をもちいた段差マイクロブリッジ型ジョセフソン素子によるマイクロ波ミキシング特性 | 42/4 |
| 福本吉人・梶川 弘・小川陸郎・川手剛雄 | |
| • 粉末法による Nb_3Sn 超電導線の履歴損失と臨界電流密度におよぼす Mn 添加の影響 | 44/1 |
| 溝俣洋一・森倉功和・井上康彦・嶋田雅生・小川陸郎・川手剛雄 | |

ダイヤモンド・カーボン関係

- 高密度アモルファスカーボンの開発と基板材料への応用 39/4
村松一生・坂下由彦・原 宣宏・大西良彦
- ダイヤ薄膜の電子デバイスへの応用 39/4
小橋宏司・宮田浩一・熊谷和夫・井上隆善・立花弘行・中上明光
- 気相合成ダイヤモンドの用途 42/2
Paul Southworth・David Buhaenko・Carolyn Jenkins
- ダイヤモンド薄膜の欠陥および界面構造 42/2
Brad E. Williams・Jeffrey T. Glass・Robert F. Davis
- ダイヤモンド薄膜の合成加工技術 42/2
小橋宏司・西村耕造・宮内重明・宮田浩一・熊谷和夫
- ダイヤモンドへのイオン注入 42/2
Kumar Das・Vasudev Venkatesan
- ボロドーピングした気相合成ダイヤモンド薄膜の電気的特性 42/2
Ruth E. Harper・Colin Johnston・Norma G. Blamires・Paul R. Chalker・Ian M. Buckley・Golder
- ダイヤモンド薄膜デバイスのシミュレーション 42/2
鈴木康平・中上明光
- 多結晶ダイヤモンド薄膜の熱処理効果と金属/真性半導体/半導体構造ダイオードの製作 42/2
宮田浩一・小橋宏司・David L. Dreifus
- In situ ドーピングによるダイヤモンド薄膜半導体素子の試作 42/2
西村耕造・加藤理枝・宮内重明・熊谷和夫・小橋宏司
- 多結晶ダイヤモンド薄膜電界効果トランジスタ 42/2
Alison J. Tessmer・Kumar Das・David L. Dreifus
- 燃焼法によるダイヤモンド合成 42/2
森西義章・鈴木富雄
- ダイヤモンド薄膜をコーティングしたスピーカ振動板の音響振動特性 42/2
田中俊光・杉本明男・木村康正・桜井 明・小橋宏司

その他

- 光ファイバの高速線引・被覆技術 38/2
秋田敏明・長岡達人
- アモルファスシリコン薄膜の光電特性 38/2
中上明光・梶川 弘・大西良彦・平井 洋
- ガラス封着用合金線の特性と製造 39/4
佐藤昌男・古賀保行・佐々木真敏・今吉義廣
- Al-Mg 合金管基板を使用した α -Si 感光ドラムの特性 39/4
林 秀高・大西良彦・梶川 弘
- 航空機電装品用薄膜ハイブリッド IC 39/4
杉山早実・小倉謙二・浜口龍生・中上明光
- 半導体製造ガス供給システム用高性能クリーンパイプの開発 39/4
泊里治夫・寺田 誠・那須 進・大見忠弘・杉山和彦・仲原喜行
- 金属アルコキシドをもちいるゾルーゲル法による $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ ファイバの作製 40/4
増田喜男・小川陸郎・川手剛雄・建石 剛
- 半導体製造ガス供給系配管用エクセルクリーン EP パイプの製造技術 41/4
桐生禎久・山田晃稔・泊里治夫・門永俊樹・植田 博
- 酸素 HIP による $\text{Ln}_{1-x}\text{Ca}_x\text{Ba}_2\text{Cu}_4\text{O}_8$ ($\text{Ln}=\text{Y}, \text{Ho}$) の高分率合成 42/2
渋谷和幸・林 征治・福本吉人・小川陸郎・川手剛雄
- 薄肉高剛性 CFRP 成形品の開発 44/3
杉野守彦・田中桂子・瀬瀬嘉照・橋本孝一・牛越憲治
- ダイヤモンド薄膜合成とプラズマ発光 45/2
小橋宏司
- 化合物半導体単結晶成長装置の開発および ZnSe 単結晶の試作 46/1
上原一浩・坂下由彦・岡田 広・川中岳穂・大元誠一郎
- 半導体生産工程物流シミュレータ 46/2
福島高司・寺田博文・梅田敏弘・大村佳也子・小西正躬・吉田智信
- 液晶性高分子の配向解析 47/1
増田 薫・西澤 節
- ITO の電子状態に及ぼす酸素欠陥およびすずの影響 47/1
水野雅夫・宮本隆志